

【11】證書號數：I299366

【45】公告日：中華民國97(2008)年8月1日

【51】Int. Cl. : C23C14/56 (2006.01) C23C16/54 (2006.01)
H01T19/00 (2006.01)

發明 全 4 頁

【54】名稱：連續式自動化表面電暈暨鍍膜處理系統

【21】申請案號：094124767

【22】申請日：中華民國94(2005)年7月21日

【11】公開編號：200704810

【43】公開日：中華民國96(2007)年2月1日

【72】發明人：許耿禎 SHEU, GEENG JEN

【71】申請人：修平技術學院 HSIUPING INSTITUTE OF TECHNOLOGY
臺中縣大里市工業路11號

【74】代理人：劉緒倫

【56】參考文獻：

TW 239225

TW 267269

TW 289127

1

2

[57]申請專利範圍：

1.一種連續式自動化表面電暈暨鍍膜處理系統，包含有：

一第一進料區，內設一第一升降移動機構，可以在一第一位置以及一第二位置間往覆移動，並可進行線性的傳遞動作；

一電暈處理區，設於第一進料區之一側，內有一移動機構，該移動機構上方設有一電暈處理之放電盤；

一第一取料反轉區，內設有一第二

升降移動機構，設於電暈處理區之一側，可以在一第一位置以及一第二位置間往覆移動，並可進行線性的傳遞動作；

5. 一第一回流區，串接連通第一進料區及第一取料反轉區，內部設有一第一回傳機構，可以進行線性的傳遞動作；

10. 一轉換器，設於該第一取料反轉區之一側，具有一取物機構；

一第二進料區，內設有一第三升降移動機構，設於該轉換器之一側，可以在一第一位置以及一第二位置間往覆移動，並可進行線性的傳遞動作；

一進料減壓區，與該第二進料區連接，該進料減壓區內設有一移動機構；

一真空鍍膜區，與該進料減壓區連接，該真空鍍膜區內設有一移動機構；

一出料增壓區，與該真空鍍膜區連接，該出料增壓區內設有一移動機構；

一第二取料反轉區，與出料增壓區連接，內設有一第四升降移動機構，可以在一第一位置以及一第二位置間往覆移動，並可進行線性的傳遞動作；

一第二回流區，串接連通該第二取料反轉區及第二進料區，內設有一第二回傳機構，可以進行線性的傳

遞動作。

2.依據申請專利範圍第1項所述之連續式自動化表面電暈暨鍍膜處理系統，其中該取物機構為一夾取臂。

5. 3.依據申請專利範圍第1項所述之連續式自動化表面電暈暨鍍膜處理系統，其中該取物機構為一吸盤。

4.依據申請專利範圍第1項所述之連續式自動化表面電暈暨鍍膜處理系統，其中該第一進料區前可設有一可除塵除靜電之清潔區。

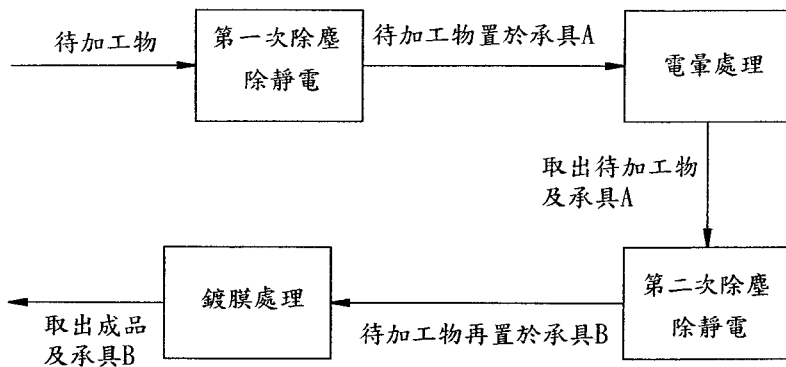
圖式簡單說明：

第一圖係為習知技術處理流程之示意圖。

15. 第二圖係為本發明中所有升降移動機構位於第一位置，將待加工物向前傳送之示意圖。

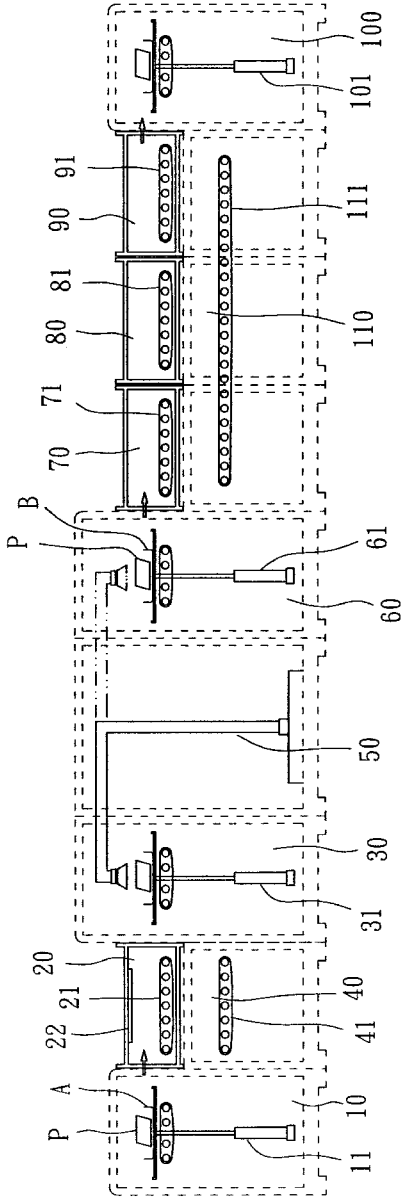
第三圖係為本發明中所有升降移動機構位於第二位置，將承具回送供循環使用之示意圖。

20. 第四圖係為本發明處理流程之示意圖。

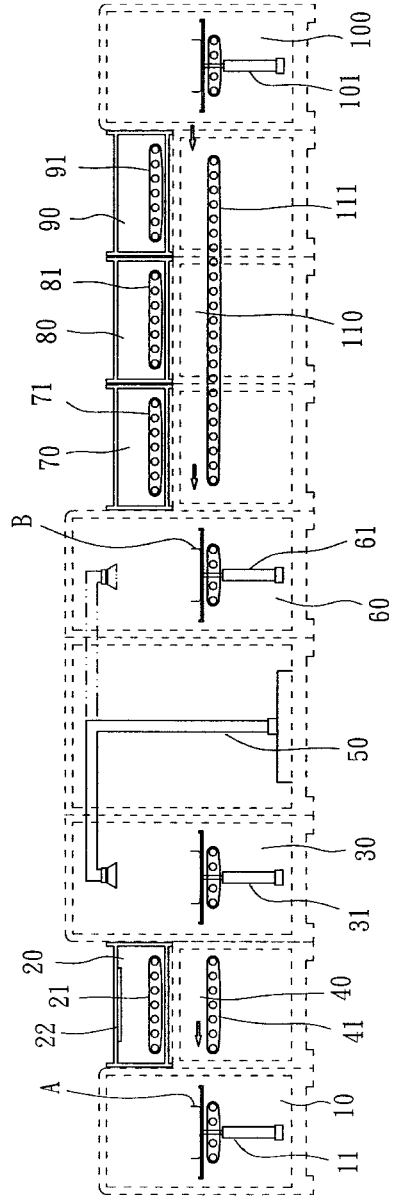


第一圖

(3)

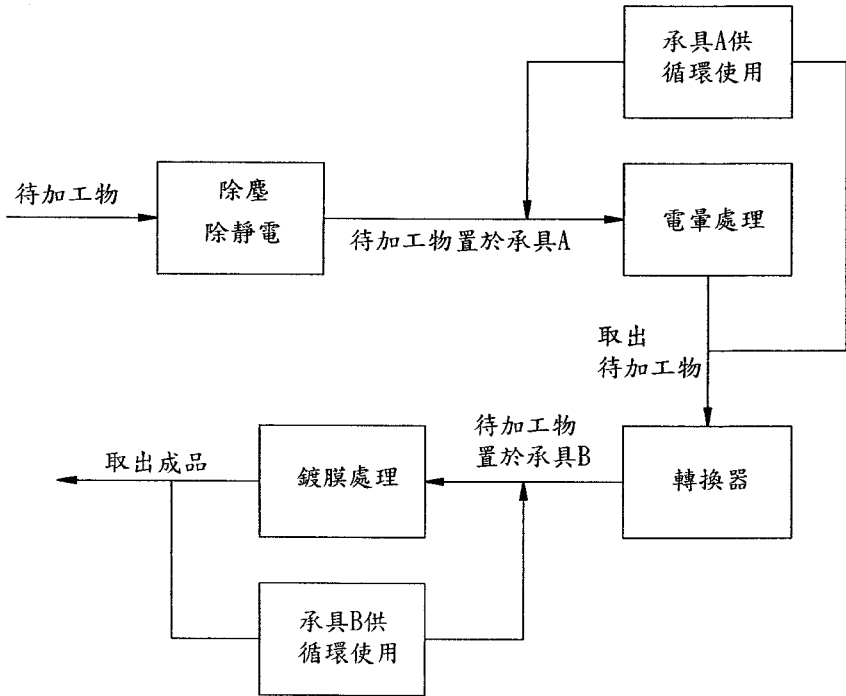


第二圖



第三圖

(4)



第四圖